

平成26年度集中講義・公開講座 技術適応計画特論

場所: 未来科学技術共同研究センター未来情報産業館 5階大会議室

	8:50-10:20	10:30-12:00	13:00-14:30	14:40-16:10	16:20-17:50
7/28 月	大規模集積デバイスの動作信頼性		新しいシリコン集積回路	新しい半導体生産方式 ～プラズマ装置編～	超純水供給技術・ 半導体表面の電子化学: 表面洗浄
	(東北大学 須川 成利 教授)		(東北大学 大見 忠弘 教授)		
7/29 火	新しい半導体生産方式 ～新ウェットプロセス装置編～	ウルトラクリーンガス 供給排気技術	FFF設計論と実績 ～クリーンルーム～	新しい半導体生産方式 ～要素技術編～	
	(東北大学 大見 忠弘 教授)				
7/30 水	～MORE THAN MOORE～ Material Innovation and Technology Fusion		『伝えたいこと』経験から学んだ新事業開発とリーダーの役割』		
	(ローム株式会社 高須 秀視 氏)		(日本ゼオン 山崎 正宏 氏)		
7/31 木	電子立国は、なぜ凋落したか		産学連携と知財戦略		
	(西村 吉雄 氏)		(東北大学 大野 茂 氏)		
8/1 金	電子デバイス新時代の到来～新ソーシャルインフラに膨大なセンサと無線半導体の需要		産業構造と成長戦略		
	(産業タイムズ社 泉谷 渉 氏)		(早稲田大学 中島 一郎 教授)		